

## 속보 자료

### 투자자 관련 담당:

Ed Lockwood  
전무 이사, 투자자 관계  
1-(408) 875-9529  
ed.lockwood@kla-tencor.com

### 언론 관련 담당:

Meggan Powers  
전무 이사, 기업 커뮤니케이션  
1-(408) 875-8733  
meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor, X5.2™ and Teron™ 611 레티클 검사 시스템 발표

### IC 반도체 팹내의 레티클 모니터링을 위한 토탈 ReQual™ 솔루션

캘리포니아주 밀피타스, 2012. 9. 5. – [KLA-Tencor Corporation](#)(NASDAQ: KLAC)은 오늘 자사의 IC 반도체 팹용 레티클 검사 포트폴리오에 추가될 신제품 2종, X5.2™ 시스템과 Teron™ 611 시스템을 발표했다. 성공적인 5XX 제품군에 추가될 최신 모델인 고성능 X5.2는 현재 사용 중인 마스크의 결함과 패턴의 저하를 검출할 수 있는 것은 물론, 앞으로 상용화될 20nm 노드에까지 기능을 적용할 수 있는 제품이다. Teron 611은 20nm 노드 이하급에 맞추어 설계된 제품으로, 첨단 IC 반도체 생산 공정에서 마스크 검사에 기술적으로 요구되는 감도를 제공한다.

KLA-Tencor 레티클 제품 사업부 사업 본부장인 Yalin Xiong 박사는 "새로운 세정 공정과 더욱 작아진 마스크 상의 패턴은 팹의 레티클 모니터링 분야에 변화를 가져왔다. 20nm 노드에서는 주 패턴과 보조 패턴의 크기가 작아질 뿐 아니라 그 둘간의 차이가 불명확해지기 때문에 결함이 웨이퍼의 패턴에 영향을 미치는지 여부를 확인하기가 더 어렵다. 또한 반복적인 마스크 세정과 웨이퍼 노광에 따른 마스크 패턴 저하 현상이 웨이퍼 공정 윈도우에 미치는 영향에 대한 고객들의 우려도 커지고 있다. X5.2 및 Teron 611 검사 시스템은 20nm 노드 이하급까지 결함과 패턴 저하를 모니터링할 수 있는 Total ReQual™ 솔루션을 구성하도록 설계되었다"고 밝혔다.

X5.2 및 Teron 611 설비는 다음과 같은 광범위한 기능을 제공한다.

- 20nm 노드의 가장 중요한 (critical layer) 마스크 검사에 기술적으로 요구되는 감도 제공(Teron 611)

- 20nm 노드의 non-critical layer 마스크와 28nm 노드 이상의 전체 마스크 세트에 대해 높은 감도 제공(X5.2)
- 마스크 세정과 웨어퍼 노광으로 인한 패턴 저하를 조기 감지하여 임계점까지 도달하기 전에 공정 윈도우가 좁아지고있는 것을 엔지니어에게 알림
- 멀티 다이 및 싱글 다이 레티클의 전체 영역을 커버하는 제 5 세대 STARlight® 검사 모드, 마스크 패턴의 edge 와 사이드월의 결함 우선 검출 및 신뢰할 수 있는 open Qz 영역의 결함 검출 성능
- 유사 결함과 중요 관심 결함(DOI)을 높은 신뢰도를 가지고 구별할 수 있는 최신 알고리즘
- 팹의 제품 조합, 제품 수명 주기 및 제품 수율 상태의 다양한 변화에 따라 감도와 속도를 조정할 수 있는 유연성 높은 아키텍처
- 첨단 설계 노드에 요구되는 업계 최고 수준의 처리량을 제공하는 옵션 구성(X5.2)
- KLA-Tencor 의 e-beam 결함 리뷰 플랫폼인 eDR-7000 과의 고유한 연결 기능을 제공하여 웨이퍼 불량 수 프로파일링 속도 및 정확성 향상

X5.2 및 Teron 611 시스템은 미국과 아시아 지역에서 유수의 여러 칩 제조업체에 납품되어 28nm 생산 라인과 20nm 시험 가동 라인에 사용되고 있다. 높은 성능과 생산성을 유지하기 위해 X5.2 및 Teron 611 도구는 [KLA-Tencor 의 포괄적 글로벌 서비스 네트워크](#)의 지원을 받는다. KLA-Tencor 의 IC 반도체 팹 기반 레티클 검사 도구에 대한 자세한 정보는 제품 웹 페이지(<http://www.kla-tencor.com/front-end-defect-inspection/rapid-ic-fab-series.html>)에서 확인할 수 있다.

#### **KLA-Tencor 소개:**

KLA-Tencor Corporation 은 공정 관리 및 수율 관리 솔루션 공급업체의 선두 기업으로서, 전 세계 고객들과 협력하여 최첨단 검사 및 측정 기술을 개발하고 있다. 이러한 기술은 반도체, 데이터 저장, LED, 태양 전지 및 기타 관련 나노 전자부품 산업에 사용된다. 업계 표준 제품의 포트폴리오와 세계적인 수준의 엔지니어/연구 팀을 보유하고 있는 KLA-Tencor 는 35 년 이상 고객을 위한 우수한 솔루션을 만들고 있다. 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사가 있는 KLA-Tencor 는 전 세계적으로 고객 영업 및 서비스 전담 센터를 운영하고 있다. 보다 자세한 정보는 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com)(KLAC-P)에서 참조할 수 있다.

## 전망 기술:

이 언론 보도 자료에서 발표된 X5.2 또는 Teron 611 시스템의 예상 성능, 반도체 산업의 추세 및 그와 관련하여 예상되는 과제, KLA-Tencor 고객의 X5.2 또는 Teron 611 도구의 예상되는 사용 방식, 새로운 기능을 수용하기 위한 X5.2 또는 Teron 611 도구의 확장성에 대한 예측, X5.2 또는 Teron 611 도구 사용자에게 예상되는 비용 및 운영상/기타 이점 등의 내용은 미래를 전망하는 내용으로, 1995 년의 Private Securities Litigation Reform Act(증권민사소송개혁법)에 따라 제정된 Safe Harbor(면책 규정) 조항의 적용을 받는다. 이러한 전망에 대한 내용은 현재 정보와 예측을 근거로 이루어졌으며 많은 위험성과 불확실성이 수반된다. 신기술 채택의 지연(비용 또는 성능 문제 또는 다른 이유로 인해), 다른 회사에서 제공하는 경쟁제품의 도입, KLA-Tencor 제품의 구현, 성능 또는 사용에 영향을 주는 예상치 못한 기술적 어려움이나 한계 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 해당 내용에서 예측된 것과 크게 다를 수 있다.

###